

## IEEE EDS Mini-Colloquium: WIMNACT 45 のお知らせ

下記 日程にて IEEE EDS Mini-Colloquium: WIMNACT 45 を開催致します。  
皆様のご参加を頂きたくご案内申し上げます。

【日時】 平成 26 年 2 月 19 日(木)9:00~19:30

【会場】 東京工業大学 すずかけ台キャンパス すずかけホール・集会室 1

下記 サイトをご参照下さい。

<http://www.titech.ac.jp/maps/suzukakedai/index.html>

<http://www.titech.ac.jp/maps/suzukakedai/rbhj1.html>

(NO.15 がすずかけホール、集会室はその 2 階になります)

【参加費】 無料(Reception 含む)

【プログラム】

9:00-17:30: Session, 17:30-19:30: Reception

9:00 - 9:15 Greeting

T. Mogami, PETRA, Chair IEEE EDS Japan Chapter

S. Deleonibus, Leti

H. Iwai, TIT

9:15 - 9:45

S. Deleonibus, Leti: Electron Devices Research in Leti

9:45 - 10:15

T. Ernst, Leti: "Nanoelectromechanical systems: paths for co-integration with CMOS"

10:15 - 10:45

M. Casse, Leti: "Advanced devices: Toward ultimate scaled NanoWire Transistors"

10:45 - 11:15

H. Iwai, TIT: "Future of electron device technologies"

11:15 - 11:45

H. Wakabayashi, TIT: "Two dimensional material device technologies"

11:45 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:30

K. Tsutsui, TIT: "Ohmic contacts formation on AlGaN/GaN HEMTs by introducing uneven AlGaN layer structures"

13:30 - 14:00

K. Kakushima, TIT: "Resistive switching of CeOx/SiO2 stacked film based on anodic oxidation and breakdown"

14:00 - 14:30

T. Mogami, PETRA: "Positive for Silicon"

14:30 - 15:00

Z. Tang, Dalian University of Technology: "Some Researches of Thermal Problem in 3D ICs"

15:00 - 15:30

H. Wong, City University of Hong Kong: "Thermal Annealing and Interface Reaction of Lanthanum-based Subnanometer EOT Gate Dielectrics"

15:30 - 16:00

S. Dong, Zhejiang University: "ESD protection of nanometer CMOS process"

16:00-16:15

Break

16:15 - 17:30

Poster Session

17:30 - 19:30

Reception

【現地連絡先】

東京工業大学 岩井研究室

〒226-8502 横浜市緑区長津田町 4259 J2 棟 12 階 1206 号室

Tel: 045-924-5471、Fax: 045-924-5584